

T.YK491

発送日付：2003. 11. 06

提出期限：2004. 01. 06

特 許 庁 意見提出通知書

出 願 人 氏 名 キヤノン株式会社
 住 所 日本国東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

代 理 人 氏 名 張 秀 吉 外 1 人
 住 所 ソウル市鍾路区内資洞 219 ハンヌリビル
 (金・張特許法律事務所)

出願番号 1 0 - 2 0 0 3 - 0 0 6 6 4 6 4

発明の名称 IMAGE PICKUP APPARATUS

本出願に対する審査結果、以下のような拒絶理由があり特許法第 63 条の規定によりこれを通知するので、意見があるか補正を行う必要がある場合は上記期限までに意見書[特許法施行規則別紙第 25 号の 2 書式]又は/及び補正書[特許法施行規則別紙第 5 号書式]を提出されたい(上記期限について毎回 1 ヶ月単位で延長を申請することができ、この申請について別途の期間延長承認通知はしない)。

[理 由]

本出願の特許請求範囲第 1 ～ 8 項に記載された発明は、その出願前にこの発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者が下記に指摘されたものにより容易に発明できたものと認められるので、特許法第 2 9 条第 2 項の規定に該当し特許を受けることができない。

[記]

本願の請求項第 1 項～第 8 項に記載された発明は光電変換領域、平坦化されたパッシベーション層(CMP 工程利用、Sio 基盤物質)、マイクロレンズ、カラーフィルタ、光学系、信号処理回路で構成された撮像装置をその技術的特徴として記載しているが、これは日本公開特許公報平 9-148550 号(1997.6.6)の受光部、平坦化された酸化膜(CMP

工程利用)、集光部の構成から同分野で通常の知識を有した者が容易に発明できた程度
のものであると認められる。(特許法第29条第2項)

[添付]

添付1 日本公開特許公報平9-148550号(1997.6.6)1部

2003年 11月 6日

特 許 庁

審査4局

半導体2審査担当官室 審査官 ファン ユン グ

51913

출력 일자: 2003/11/7

발송번호 : 9-5-2003-044189409
발송일자 : 2003.11.06
제출기일 : 2004.01.06

수신 : 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&
장 특허법률사무소)
장수길 귀하

110-053

특허청 의견제출통지서



출원인 명칭 캐논 가부시끼가이샤 (출원인코드: 519980959073)
주소 일본 도쿄도 오오따구 시모마루코 3쵸메 30방 2고
대리인 성명 장수길 외 1 명
주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)
출원번호 10-2003-0066464
발명의 명칭 활상 장치

HISK (문항)

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인 통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-8항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

본원의 청구항 제1-8항에 기재된 발명은 광전변환영역, 평탄화된 패시배이션층(CMP 공정 이용, Sio 기반 물질), 마이크로렌즈, 칼라필터, 광학계, 신호처리회로로 구성된 활상장치를 그 기술적 특징으로 기재하고 있으나, 이는 일본공개특허공보 평9-148550호(1997. 6. 6)의 수광부, 평탄화된 산화막(CMP 공정 이용), 집광부의 구성으로부터 동 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로 인정됩니다.

(특허법 제29조 제2항)

[참 부]

첨부1 일본공개특허공보 평9-148550호(1997.06.06) 1부 끝.

2003.11.06

특허청

심사4국

반도체2심사담당관실

심사관 황윤구



출력 일자: 2003/11/7

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5741 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위
위기가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터